

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 8 月 23 日 (2007.8.23)

【公開番号】特開 2002-261156 (P2002-261156A)

【公開日】平成 14 年 9 月 13 日 (2002.9.13)

【出願番号】特願 2001-57711 (P2001-57711)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 N

H 0 1 L 21/30 5 7 2 A

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 6 月 20 日 (2007.6.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を処理するための処理室と、前記処理室内に設けられ前記基板を載置及び加熱するサセプタとを有する基板処理装置において、前記サセプタ上に、前記基板を処理する時に前記基板を前記サセプタから浮かせるように支持するための複数のピンが、頂部が前記サセプタの表面から突出する状態で設けられ、前記ピンはピンの高さを変更可能とすることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の基板処理装置において、ピンの高さを変更することによって、アッシング条件を変更可能なことを特徴とする基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明においては、請求項 1 に記載したように、基板を処理するための処理室と、前記処理室内に設けられ前記基板を載置及び加熱するサセプタとを有する基板処理装置において、前記サセプタ上に、前記基板を処理する時に前記基板を前記サセプタから浮かせるように、支持するための複数のピンが、頂部が前記サセプタの表面から突出する状態で設けられ、前記ピンはピンの高さを変更可能とすることを特徴とする基板処理装置を構成する。

また、請求項 2 に記載したように、請求項 1 に記載の基板処理装置において、ピンの高さを変更することによって、アッシング条件を変更可能なことを特徴とする基板処理装置を構成する。